

第19回 JICC洗淨技術フォーラム2015

～産業洗淨はモノづくりのキーテク、2015優秀新製品賞受賞講演～

開催日時：2015年12月 3日(木) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 会議棟6F (608会議室) 定員：120名

対象：今そして将来の洗淨を考える洗淨ユーザー、研究者、設計者、技術者
洗淨剤・洗淨機及びその周辺機メーカーの管理者、開発者、技術者
有力な商材・技術を求める商社・販売店の皆様

主催：日本産業洗淨協議会 (JICC) TEL: 03-3453-8165 (10月 9日(金)まで)
TEL: 03-5777-0791 (10月13日(火)より)

講演・発表プログラム

【フォーラム】	開会挨拶・技術発表 (主催：日本産業洗淨協議会) 会場：会議棟 6F 608 会議室 司会：守田章治 (クロロカーボン衛生協会) 前野純一 (荒川化学工業㈱)
10:00～10:05	開会挨拶：目黒 弘 日本産業洗淨協議会会長 日本ソルベイ株式会社 代表取締役社長
10:05～10:40	技術発表「小径基板の洗淨品質の常識を変える」 ～基板メーカーが提案する洗淨技術へのブレークスルー～ 並木精密宝石株式会社 エヌ・ジェイ・シー技術研究所 石田 悠宗氏
10:40～11:15	技術発表「ペーパーゾーンがなくても、溶剤洗淨ができる『グリーンペーパー洗淨機』について」 ジャパンフィールド株式会社 システム部 取締役営業技術部長 泉田 義彦氏
11:15～11:50	技術発表「新型ワンバス式真空洗淨乾燥機『HEARVY』について」 株式会社クリンビー 代表取締役社長 岡村 和彦氏

洗淨総合展 【特別講演】 13:00～14:00	会場：会議棟 6F 605-606 会議室 「航空機部品などの加工・造形の最新トレンド」 ～難削材の切削・洗淨から AM(3D プリンティング)技術まで～ 東京農工大学大学院 笹原 弘之教授
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

【フォーラム】	招待講演と技術発表 (主催：日本産業洗淨協議会) 会場：会議棟 6F 608 会議室 司会：山本保夫 (日本産業洗淨協議会 シニアアドバイザー) 白砂勝利 (日本ソルベイ㈱)
14:20～15:05	招待講演 「マイクロバブル流による洗淨過程の可視化と洗淨機構」 群馬大学大学院理工学府 知能機械創製部門 <small>あまが</small> 天谷 賢児教授
15:05～15:40	技術発表「次世代超純水向け酸化性物質除去触媒『オルデトックス』について」 オルガノ株式会社 開発センター 新領域グループ 林 佳史氏
15:40～15:50	(休憩)
15:50～16:25	技術発表「炭化水素系マイクロエマルジョン洗淨剤 『NS クリーンM タイプ』 について」 J X 日鉱日石エネルギー株式会社 機能化学品カンパニー 工業用洗淨剤事業ユニット 工業用洗淨剤事業グループ 担当マネージャー 山内 辰也氏
16:25～17:00	技術発表「一液型洗淨剤『パインアルファ ST-251EVA』 について」 荒川化学工業株式会社 電子材料事業部 研究開発第二部 研究員 井内 洋介氏

フォーラム聴講費 (税込み・カラーテキスト代を含む)

会員：13,000 円/人

非会員：17,000 円/人

◎フォーラム会場の出入りは、予めお送り致します「聴講券」で自由に行えます。